

## 放射光産業利用懇談会

講演会（第5回）

共 催：電気学会 / 光・量子デバイス技術委員会  
 後 援：(財)大阪科学技術センター  
 (社)大阪ニュークリアサイエンス協会  
 日 時：平成8年12月13日(金)13：30～17：00  
 場 所：住友重機械工業(株)本社ビル13F大会議室  
 東京都品川区北品川5-9-11（住友重機械ビル）  
 ：JR山手線「大崎」駅下車徒歩8分  
 大学、国立研究所の方は参加自由です。  
 事前に事務局（米倉TEL：0775-61-2806 FAX：0775-61-2859）  
 まで、所属、お名前をお知らせ下さい。  
 また、企業の方の参加は、共催団体の会員に限らせていただきます。

## テーマ「放射光による半導体加工プロセスの最先端」

## □ 講 演

13：30～13：40

開会挨拶

13：40～14：20

放射光リングラフィ開発の現状と展望

日本電気(株)マイクロエレクトロニクス研究所 担当部長 鈴木 克美

14：20～15：10

放射光による半導体加工研究の現状と展望

分子科学研究所 反応動力学研究部門 教授 宇理須恒雄

15：10～15：25 休 憩

15：25～16：05

放射光を用いたSi低温固相成長（SPEXI）

日本放送協会 放送技術研究所 主任研究員 佐藤 史郎

16：05～16：45

NTTにおける放射光利用研究の現状

NTTシステムエレクトロニクス研究所 主任研究員 内海 裕一

16：45～17：00

開会挨拶 - 小型光源開発の紹介を含めて

住友重機械工業(株)量子技術研究所 所長 飯倉 督夫